EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59168403

PUBLICATION DATE

22-09-84

APPLICATION DATE

15-03-83

APPLICATION NUMBER

58043826

APPLICANT:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;

INVENTOR:

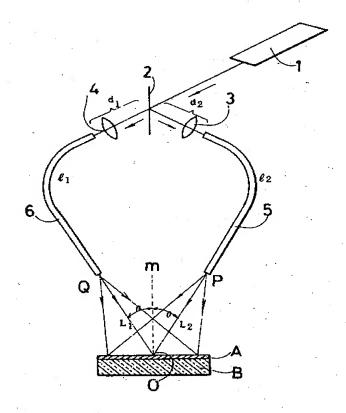
OKAMOTO KENJI;

INT.CL.

G02B 5/18 G02B 5/14

TITLE

EXPOSING DEVICE



ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the size of an optical system on the whole by splitting laser light into two pieces of luminous flux through an exposing device for manufacturing a diffraction grating, and irradiating a photosensitive material with them from the opposite sides and exposing the material with interference fringes.

CONSTITUTION: A laser light source 1 uses, for example, an He-Cd laser with coherence, and the laser light is split by a half-mirror 2 into two pieces of luminous flux. Those two split pieces of luminous flux are converged by condenser lenses 3 and 4 to strike end surfaces of single-mode optical fibers 5 and 6, and the pieces of luminous flux are curved and projected from the other-side ends of the optical fibers 5 and 6. Then, the projection lights from the single- mode optical fibers 5 and 6 are made incident to the surface formed of a substrate B and the photosensitive material A at different angles of incidence. Projection-side end points P and Q of the optical fibers 5 and 6 are narrow, so the laser light is emitted into the air as a spherical surface wave to form interference fringes consisting of a group of equal-interval parallel straight lines on the photosensitive material A.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

	•		•
		•	
	•	• . •	r in the second
	•		the second second
	•		, ,
			•
			•
	•		
			* 1
	· .		
			. *
	•		
•		1	
		,	
	•	· · · · · ·	
		,	
g. ·	•	•	•
	,		
			•
	(i) •		
			•
	•		•
			•
Y .			
		•	
	,		4
		•	
		į.	
		•	
		•	
	* *		
	•		
		:	
			•
			•
		•	-8-
			•
· You			8*
		• •	
		4	
	•	v ·	•

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

型公開特許公報(A)

昭59-168403

⑤Int. Cl.³ G 02 B 5/18 5/14 識別記号

庁内整理番号 7529—2H A 7370—2H 砂公開 昭和59年(1984)9月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

邻露光装置

.

頭 昭58-43826

岡本賢司

②特 ②出

頭 昭58(1983)3月15日

⑩発 明 君

大阪市此花区島屋1丁目1番3

号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

勿出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

羽代 理 人 弁理士 川瀬茂樹

明 細 也

- 1. 発明の名称 窓 光 装 電
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 可干渉性を有するレーザ光減と、レーザ光を2光束に分離するハーフミラーと、前記2 光束を集光する2の集光レンズと、集光レンスからの光束を導き感光性材料に対し互に異なる入射角をなすよう照射させ被感光性材料の上に球崩波状の干渉総を認光する2本のシングルモード光ファイバとよりなる事を特徴とする端光装置。
 - (2) レーザ光源が He Cd レーザである特許制 求の範囲第(1)項記載の露光装置。
 - (3) レーザ光源が Ar レーザである特許請求の範囲 第(1) 項記服の端光装置。
 - (4) シングルモード光ファイバは石灰茶ファイバである特許請求の施យ第(1)項配制の露光装置。

3. 発明の詳細な説明

(7) 要約

回折格子を作製するための総光装置で、レーザ 光を2 光束に分けて、これを互に反対側から感光 性材料に照射して干渉総を観光する。分離した2 光束はシングルモード光ファイバを過過させ、光 ファイバの端点から球面波として出射する。干渉 縮は平行な値線ではなく、球面波による干渉絡と なる。しかし、光ファイバ出射端と感光面が十分 離れていれば、干渉絡はほぼ平行な直線群となる。

(f) 技術·分里

光通信の分野に於て、回折格子は重要な一瓣成要素である。被長選択性の良いことから、 反射型として、 波長分波、合波素子に用いられる。また、 光導波路に装荷させた素子として、フィルタ、 分 布滞置型レーザ等、重要な素子を解成できる。

光銀祖回路の一棚成要素としての、導波路上の 同折格子を例にとつて考える。この場合、回折格子の周期は、導波路中を伝搬する光の波長よりな お小さいのが普通である。

特開昭59-168403(2)

このため、回折格子を作製するには、非常に微細で、かつ高精度の加工技術が要求される。このように微細な回折格子を機械的方法で作るのは難しい。

そこで、第4図に示すような二光東干渉選光法が用いられる。これは、レーザ光を2光東に分け、これを平面波として、2方向から感光性材料に入射し、平行直線群の干渉線を露光するものである。

二光東は平面波であるから、その光軸と法線 m とが同一平面上にあるようにすれば、二光東が感

一などを組合せているから、機械的振動の影響を受けやすい。機械的振動の振幅が値かであつても、作製すべき阿折格子の周期が小さいのであるから、干渉縞の形成に悪影響を及ぼす。

さらに、露光装置の全体が大きなスペースを必要とする、という欠点がある。

ミラー、レンズ等の光学部品を定盤の上に固定したもので露光装置を構成していたからである。 定盤は重く、大きいものであるから、露光装置を 大がかりなものになる。干渉縮周期は、入射角を り、レーザ波接を入として、入/2 sin 0 で与えられ る。特に干渉絡周期を大きくするため、 0 を小さく くしたい場合があるが、 0 を小さくするためには ミラーから基板Bまでの距離が極めて接くなる。 このような理由で、露光装置を小型にすることが できない。

(エ) 球面波の干渉縞パターン

本発明者は、従来の二光東干沙露光法が、ミラーやレンスを多用するところにその弱点がある事 に気付いた。 光性材料Aの上に作る干砂線は、等間隔の平行直線群になる。

このような配置で露光した後、感光性材料を適当に処理すれば、感光性材料又は基板によって樹成される回折格子を得ることができる。

このような二光恵干渉露光法は、レーザ光の波 長のオーダーの側巖の回折格子を作ることができ るし、周期性も良い。

しかし、なお欠点もある。

(ウ) 従来の二光東干渉露光法の欠点

このような二光東干渉鑑光法の欠点は、まず干渉総パクーンが乱れやすい、という事である。

コリメート光学系14、15に、ミラー16、 17を用いるから、レンズやミラーにホコリ、汚れが付着し、或は傷がつくこともある。このようなホコリ、傷は露光面にスペックルバターンを生する原因となる。

光の伝搬媒質として空気を用いているが、空気 の密度変化による屈折率のゆらぎなどが、干渉腐 パクーンに影響を生する。さらに、レンズ、ミラ

そこで、本発明者は、ミラーやレンスよりなる 光学系を、シングルモード光ファイバで置換える 事を考えた。

コリメート光学系で 2 光東を平行光に拡大して (平面波)干渉させると、干渉縞は平行直線群に なる。

光ファイバだけを用いる場合、平面波を作ることができないので、球面波となる。光ファイバの出射端からの球面二光束を干渉させると、どのような干渉縞が平面上に生ずるのか?まず、この点について述べる。

第2図は球面波の干渉を考察するための構成図である。

2 つの点光顔P、Qから球面波が出るものとする。 y z 平面上の干渉縞について考察する。 x 軸が法線である。

干渉絡は、光源P、Qからの距離の差が一定である軌跡に沿つて生ずる。

2点からの顕縦の遊が一定である図形は、回転 双曲面である。つまり、P、Gを焦点とする双曲 線を、直線PGのまわりに回転してできる図形で ある。

直線PQと離隔したyz平面上に生する干渉縞は、前記の回転双曲面とyz平面の交線として与えられる。これは双曲線に似ているが、双曲線ではない。

さて、問題はyz平面での、直線PQの方向への干渉縞の問題のバラつきである。

つまり、第2図に於て、2軸方向への干渉額問題が問題である。

球面波を干渉させた場合の干渉縞バクーンの周期については、Suzuki A., K.Tada"Fabrication of Chirped Grating on GaAs Optical Wavequides."
Thin Solid Films, vol.72, No.3,p419 に詳しく 説明されている。

z 軸上の干渉総属期Λに対、z 軸上の点Rを考え、PRとRQの登△に屈折率πを乗じ、これをz で微分したものでλoを除すれば求めることがで

縦軸は

$$\frac{\Lambda \ (L/2) - \Lambda \ (0)}{\Lambda \ (0)} \qquad \cdots \qquad (3)$$

の値である。

GaAs 分布帰還レーザ用 クレーティングを想定し、 Λ (0) = 0.345 μ m 、 λ_0 = 0.325 μ m 、 n = 1 、 θ_a = θ_n = 28.1 ° として、定数を決定した。

クラフは、下から暦に、L = 0.4 m、 1.0 m、 2.0 m のものを示す。 L/2 は随折格子を作るべき 領域の選鉛までの原点からの長さである。 従つて 同折格子の長さかしであると考えてよい。

光集増固路などの中には回折格子を作るのであるから、河折格子の長さしは小さい。そして、マアイバ論点に該当する点P、 Qから格子消までの 犯能 Caか大きければ、格子海斯 A (2) のずれは 10 以下に狂えられる。これは格子海斯の前に換算すると、 10 A のオーケーである。殆ど問題になら

つまり、第2図に於て、 z 鱇方向に毎毎野闘器 な平行直線群が、干渉総として生する、とみなす。

n dL である。これを計算すると、干渉総周期は

$$\Lambda(z) = \frac{\lambda_{b}}{n} \left\{ \frac{\ell_{a} \sin \theta_{a} + z}{(\ell_{a}^{2} + 2z \ell_{a} \sin \theta_{a} + z^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{\ell_{b} \sin \theta_{b} - z}{(\ell_{b}^{2} - 2z \ell_{b} \sin \theta_{b} + z^{2})^{\frac{1}{2}}} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

となる。

z 軸上で、原点 (z = 0) に於て Λ (z) は 股小である。原点より離れるに従つて、干渉総周期 Λ (z) は僅かずつ増加する。

↑ (z) は一定ではなく、 z = 0 を ស小とする下に 凸な函数である。しかし、 z の値が小さい限り、 ↑ (0) からのズレは小さい。

第 3 図は z=L/2 の点での Λ (z) の値が、原点での値 Λ (0) よりどれほど大きいかを示すグラフである。 $\ell_a=\ell_b$ 、 $\ell_a=\ell_b$ という条件で、 \overline{M} 軸を変数 ℓ_a としている。つまり、 y ェ平面の中心 O と点光源との距離である。これは $0\sim800$ 年について示した。

ことができる。

球面波の干渉縞であるが、 ℓ_a が大きく、 L が小さいので、平面波の干渉縦とほぼ回じものになるのである。

(オ) 本発明の露光装置

本発明の露光装置は、球頭波の干渉を利用する。 第 1 図は本発明の露光装置の光学系解成図であ

レーザ光線 1 は可干渉性のある光を生する。レーザ光線 1 として、例えば、 He — Cd レーザ(波長 4416Å)を用いる事ができる。

レーサ光はハーフミラー 2 によつて、 2 本の光 更に分けられる。分離された 2 光爽け、 集光レン ズ 3 、 4 によつて 集光されて、 シングルモード光 ファイバ 5 、 6 の端面に入射する。 シングルモー ド光ファイバ 5 、 6 は、 適当に 傾曲 して おり、 光 空を蜷曲させて、 他方の端面から出射する。

建版日、感光性材料Aのなす面に対して、それ ぞれのシングルモード光ファイバ 5、 6 の出射光 が互に異る入射角で入射する。この例では、簡に 立てた法線mに関し、2光東は互に斜反対側から 人射し、角の、一のをなすようになつている。しかし、必ずしも、角度の絶対値が等しくなければ ならないという事はない。

シングルモード光ファイバ 5、 6 の出射 観 端 点 ド、 Q は十分狭いので、レーザ光は球面波として、 独間中へ出射される。

平面波ではなく、球面波であるから、2 光線が 感光性材料 A の上で作る干渉線は、等間窓の平行 直線群ではない。しかし既に説明したように、点 P、 Q と干渉平面との距離が長く、干渉領域の長 さか小さい場合、球面波であつても、干渉器はほ 分平行直線群になる。

従つて、点P、Qからの球面波レーザ光によつて、感光強材料Aの上に等間選、平行直線許よりなる干渉級が鑑光される。

窓光性材料はフォトレジスト、サーモフラスチンクなど公知のものを使用できる。

露光した後、現像、エッチング、その他の通常 の工程により、感光性材料そのものに、或は基板

一 散乱により、 $0.4~\mu m$ 程度の 波 長 の 光 は 散乱 さ れ て 、 伝 送 損 失 は $30~\sim50~$ dB/am で ある 。 し か し 、 光 フ ア イ バ の 良 さ ℓ_1 、 ℓ_2 は 数 十 m 程 度 で あ る か ら 、 こ こ で の 伝 送 損 失 は 極 め て 僅 か で あ る 。

(カ) 効 果

シングルモード光ファイバを用いて 2 光東を轉出させて露光すべき面を照射するようにしている。レンズやミラーを用いていないから、レンズ、ミラーにつくホコリ、汚れによるスペックルバターンが殆ど現われない。また、レンズ、ミラーを固定するための定盤などを要しないから、光学系の全体を小さくすることができる。

空気中を伝搬する部分が小さくなるから、空気 の服折率のゆらぎの影響も受け難くなる。

本発明は、光集機回路の中の回折格子、反射型の回折格子その他を作製するための露光装置として用いる事ができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の露光装置の光学系構成図。

に回折格子を形成する事ができる。

レーザ光の干渉は、 両光束の光路差が、 そのレーザ光源のコヒーレント 長以下でないと生じない。レーザ光源が He - Cd レーザ (波長 4416 Å)の場合、コヒーレント長は 2 cm 程度である。

ハーフミラーから光ファイバの入射端までの距離を d1、d2、光ファイバの長さを 61、62、ファイバの出射端から基板までの距離を L1、L2とする。 光路 釜 $\triangle 6$ は

 $\Delta \ell = ! (d_1 + \ell_1 + L_1) - (d_2 + \ell_2 + L_2) |$(4)

△ℓ がコヒーレント長以下である、という制限 がある。しかし、これは容易に満足させることが できる綴い制限である。

レーザ光源は、短波長レーザを用いる必要がある。 光ファイバ中での伝送損失を少くするため、 石英系のシングルモード光ファイバを使用するのがよい。

波長 λのマイナス 4 乗 (λ)に比例するレイリ

第2図は球面波の干渉を説明するための略図。 P、Qは点光源、z軸は干渉平面の内PQの方向にとつた墜標、x軸は干渉平面の法線に平行にとってある。

第 3 図は珠面波の作る干渉総の周期が、z = 0 とz = L/2の点で、どれほど異るかを示すグラフ。 機軸は点光源と平面の原点Oとの距離 ℓ_a 、縦軸は、 干渉総周期の差を z = 0 に於ける干渉総周期で除 した(Λ (L/2) - Λ (0)) / Λ (0) の値を示す。L = 0.4 = 、1.0 = 、2.0 = の場合を図示した。

第 4 図は従来例に係る二光東干渉露光装置の光 学系構成図。

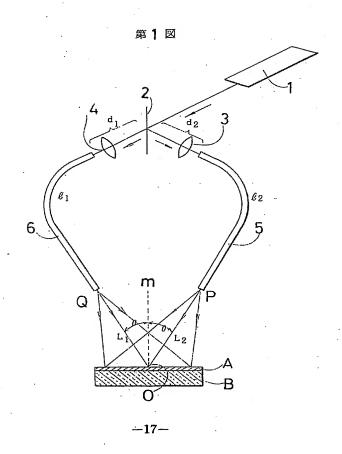
1 --- レーザ.光 瀬

3、4…… 集光レンズ

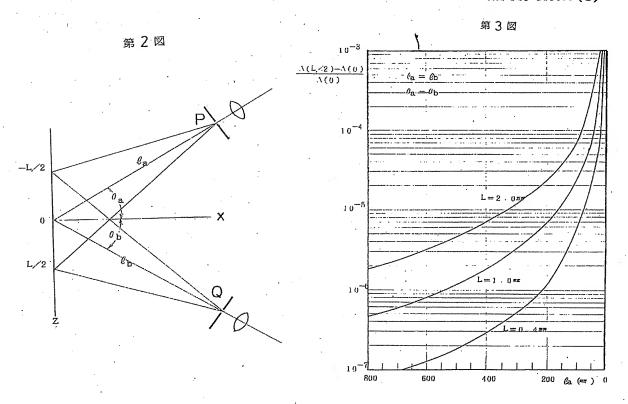
5 、 6 … … シングルモード光フアイバ

特開昭59-168403(5)

0 ……… 入 射 角
 d₁、d₂ …… ハーフミラーから光フアイバ端までの距離
 l₁、l₂ …… 光ファイバの長さ
 L₁、L₂ …… 光ファイバ端から港板中心



特開昭59-168403(6)



第4図

